

全自動RTP（高速熱処理）装置

RTP-1200Aシリーズ

特徴 & 利点

4~8インチに対応した、シングルチャンバ全自動RTP装置です。搬送方式はオープンカセット・SMIFどちらかの選択で、カセットステーションは2台になります。

ウェハをサセプタに格納してプロセス処理をするため、反り、厚さ、透過率等のウェハの特性に関わらず、抜群のRc・温度均一性を実現します。

熱源はハロゲンランプで、上下両面配列です。温度測定範囲は20°C~1250°Cとなります。熱電対とパイロメータがリアルタイムの温度測定をし、その結果をスマートPIDおよびマルチゾーンSCRが制御することで、優れた温度コントロールを可能にします。

真空チャンバ内には酸素濃度モニターを搭載し、酸素フリーな環境維持をサポートします。Windowsベースのソフトウェアはマルチリンガル対応。グラフィカルなユーザーインターフェースで直観的な操作を可能としています。

累積出荷台数500台以上の実績で得られたプロセスプロファイリングのノウハウと、常時5台用意されたデモ環境で、貴社のプロセス開発における課題解決のお手伝いを致します。

アプリケーション

- インプラ後のアニーリング
- ドーパント活性化
- 金属膜コンタクトアニーリング
- シリサイド形成
(チタン、コバルト、ニッケル、白金など)
- ソース/ドレインアニーリング

